



股票代號：3551

世禾科技股份有限公司
Shih-Her Technologies Inc.

股票上櫃前法人說明會簡報

報告人：陳學哲 總經理

97 年 04 月 10 日

簡報綱要



一、公司簡介	2
二、產品與市場	7
三、經營實績	18
四、競爭利基	22
五、研發成果及未來計畫	25



一、公司簡介

基本資料



成立日期：86年6月23日

董事長：陳學聖

總經理：陳學哲

實收資本額：新台幣339,423,500元整

員工人數：**508**人

公司地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路17之2號

營業項目：半導體、光電及太陽能製程設備零組件
之精密洗淨及再生處理

工廠簡介



世禾一廠：土地面積：539坪
新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路17之2號



世禾二廠：土地面積：994坪
新竹縣湖口鄉新竹工業區復興路30號



世禾三廠：土地面積：3,884坪，台南市安南區台南科技工業區工業二路35號



註：世禾四廠：土地面積：1,007坪，新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(建造中)

Shih-Her Technologies INC.

公司沿革



年 月	記 要
86年06月	公司及一廠設立，專注於專業再生洗淨處理服務。 實收資本額為新台幣5,000仟元。
87年06月	開始處理CD-RW濺鍍設備治具、零件之再生洗淨。
91年11月	通過ISO 9001：ISO 2000品質認證。
92年02月	設立湖口復興二廠，進行光電及平面顯示業之製程設備零組件精密洗淨及再生處理。
94年01月	設立台南三廠，成為奇美光電之最大平面顯示器生產設備零組件專業精密洗淨及再生處理供應商。其設備最大可處理能力包含8代LCD顯示器尺寸在內之零組件。
95年01月	接獲美國太陽能電池製造大廠SunPower之精密洗淨及再生處理訂單，開始切入太陽能產業之設備元件表面處理服務。
95年12月	經「行政院金融監督管理委員會證券期貨局」核准公開發行。
96年02月	經「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」核准興櫃股票櫃檯買賣。
96年03月	購入新竹湖口工業區仁政路18號土地，進行擴建第四廠。
96年11月	經「行政院金融監督管理委員會證券期貨局」核准上櫃申請案。
97年4月	本公司股票正式上櫃掛牌交易。

- 服 務 客戶至上，提供完整之服務價值鏈。
- 創 新 致力研發，不斷推出創新洗淨及再生處理製程。
- 成 長 行銷國際，快速複製成功商業模式。
- 分 享 利潤分享，與員工及股東共享成果。

二、產品與市場

精密洗淨及再生處理零組件種類



半導體生產
設備零組件



TSMC 12" wafer Chamber



TSMC 8" Heater Chamber Lid



TSMC 12" Etcher Quartz Bell Jar

TFT-LCD生產
設備零組件



Gen. 6th TFT Sputter Panel



Gen. 6th TFT Sputter Panel Holder



Gen. 7.5th Color Filter Module Masks

太陽能及硬碟
生產設備零組件



SunPower 240KVA Solar Cell
Panel Sputter Chamber Grid
Tray



SunPower 240KVA Solar Cell
Panel Sputter Chamber Trays



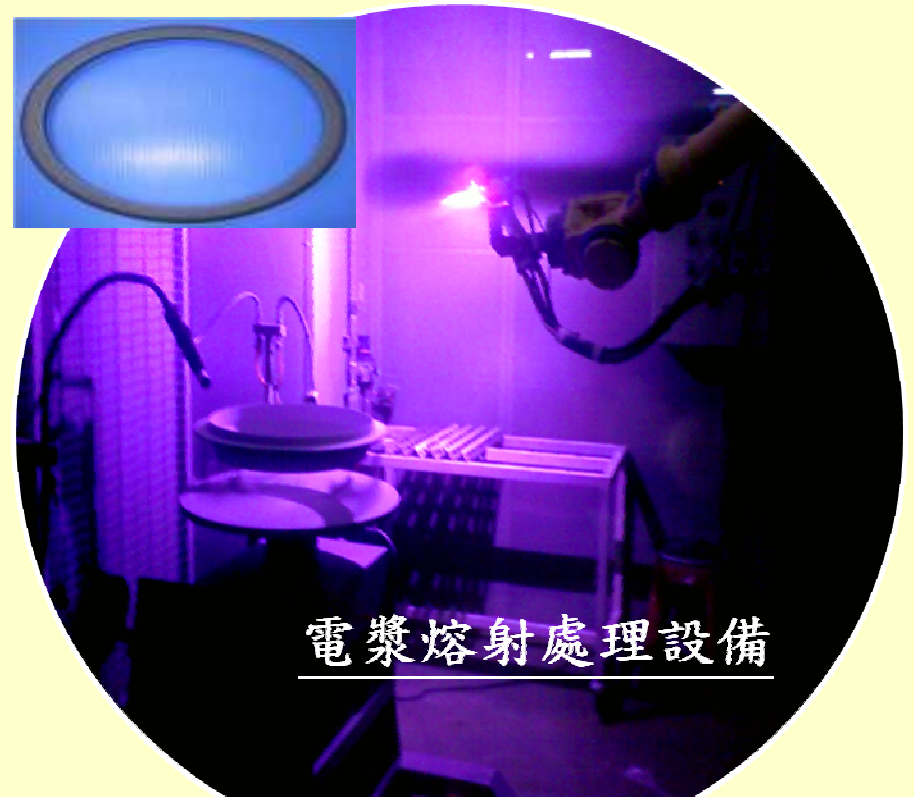
Trace Storage Hard Disc Driver
Floppy Sputter Chamber Kids

主要精密洗淨及再生處理設備

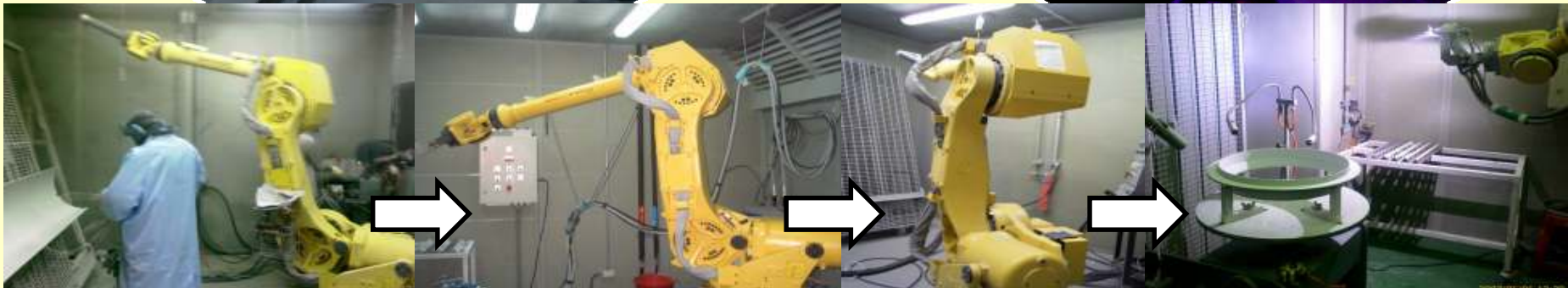
SHT



電弧熔射處理設備



電漿熔射處理設備

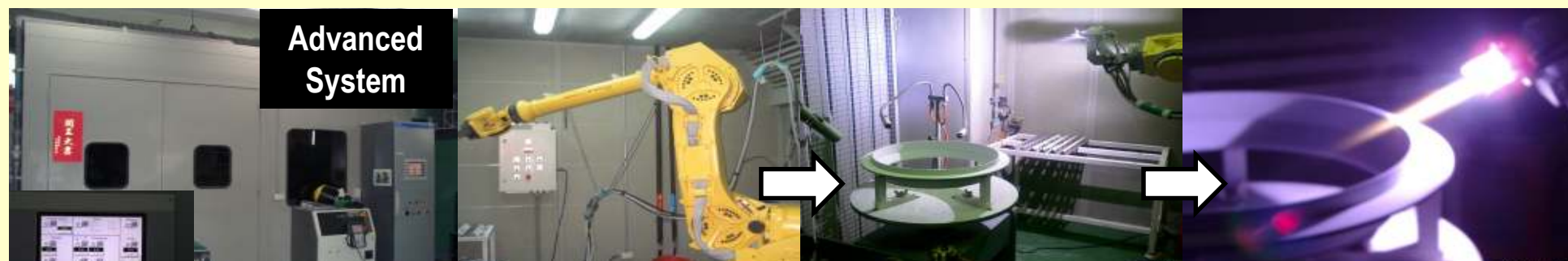


以機械手臂(Robotic System)進行電弧及電漿熔射塗層 (coating) 自動化施工

電弧熔射處理設備之主要施工服務產品



電漿熔射處理設備之主要施工服務產品



Robotic Spraying Protective Coating on 12" wafer vacuum Chamber parts



主要精密洗淨及再生處理設備



Particle 檢測儀



檢測機操作畫面



表面粗度計



高度
測量儀

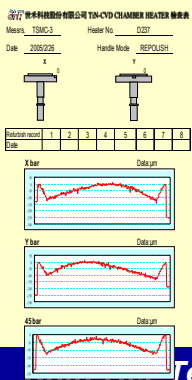


大型液壓整型機

品保檢測及
整型設備



大理石檢測台



Heater Profiler



2008/4/15



Ring-chuck 測量儀

矽晶元濺鍍用加熱器表面曲線量測儀



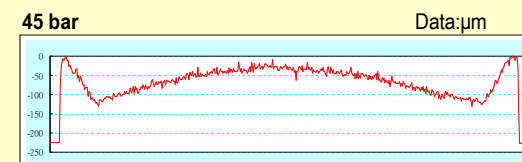
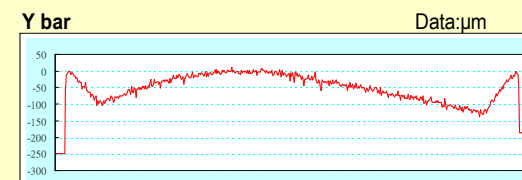
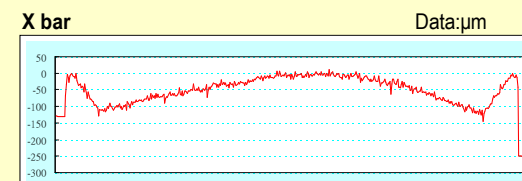
SHT 世禾科技股份有限公司 TiN-CVD CHAMBER HEATER 檢查表

Messrs TSMC-3 Heater No. D237

Date 2005/2/26 Handle Mode REPOLISH



Refurbish record	1	2	3	4	5	6	7	8
Date								



Heater Profile Tester

市場佔有率及目標



目前市場佔有率

Semiconductor PVD Lines: 70%

Semiconductor CVD Lines: 5%

Semiconductor Etcher Lines: 10%

TFT LCD Array: 60%

TFT-LCD Color Filter: 80%



未來預估市場佔有率

Semiconductor PVD Lines: 85%

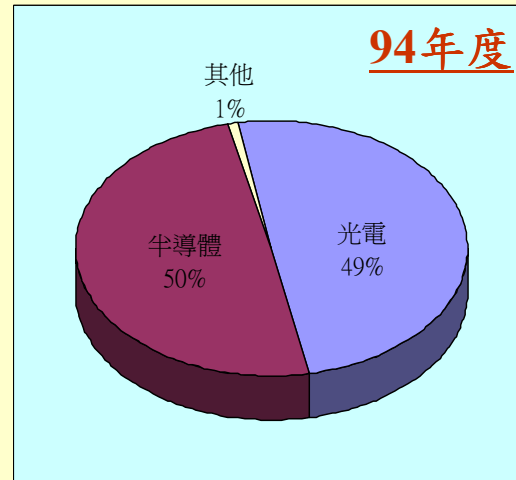
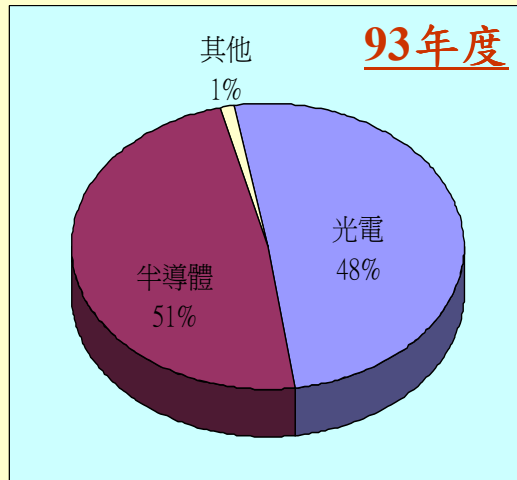
Semiconductor CVD Lines: 50%

Semiconductor Etcher Lines: 60%

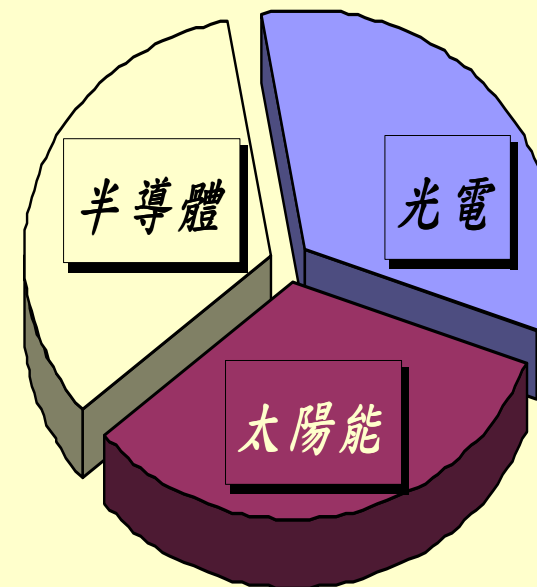
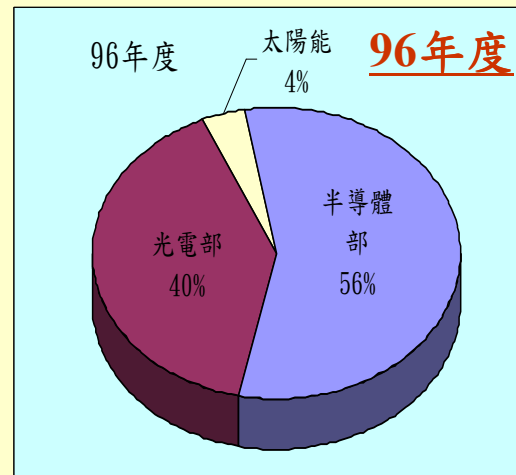
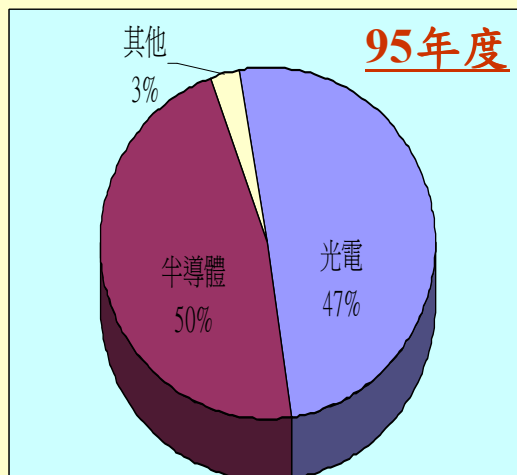
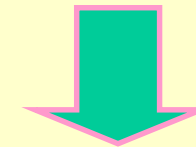
TFT LCD Array: 75%

TFT LCD Color Filter: 90%

精密洗淨及再生處理產業類別分析



未來方向



主要客戶-半導體

SHT



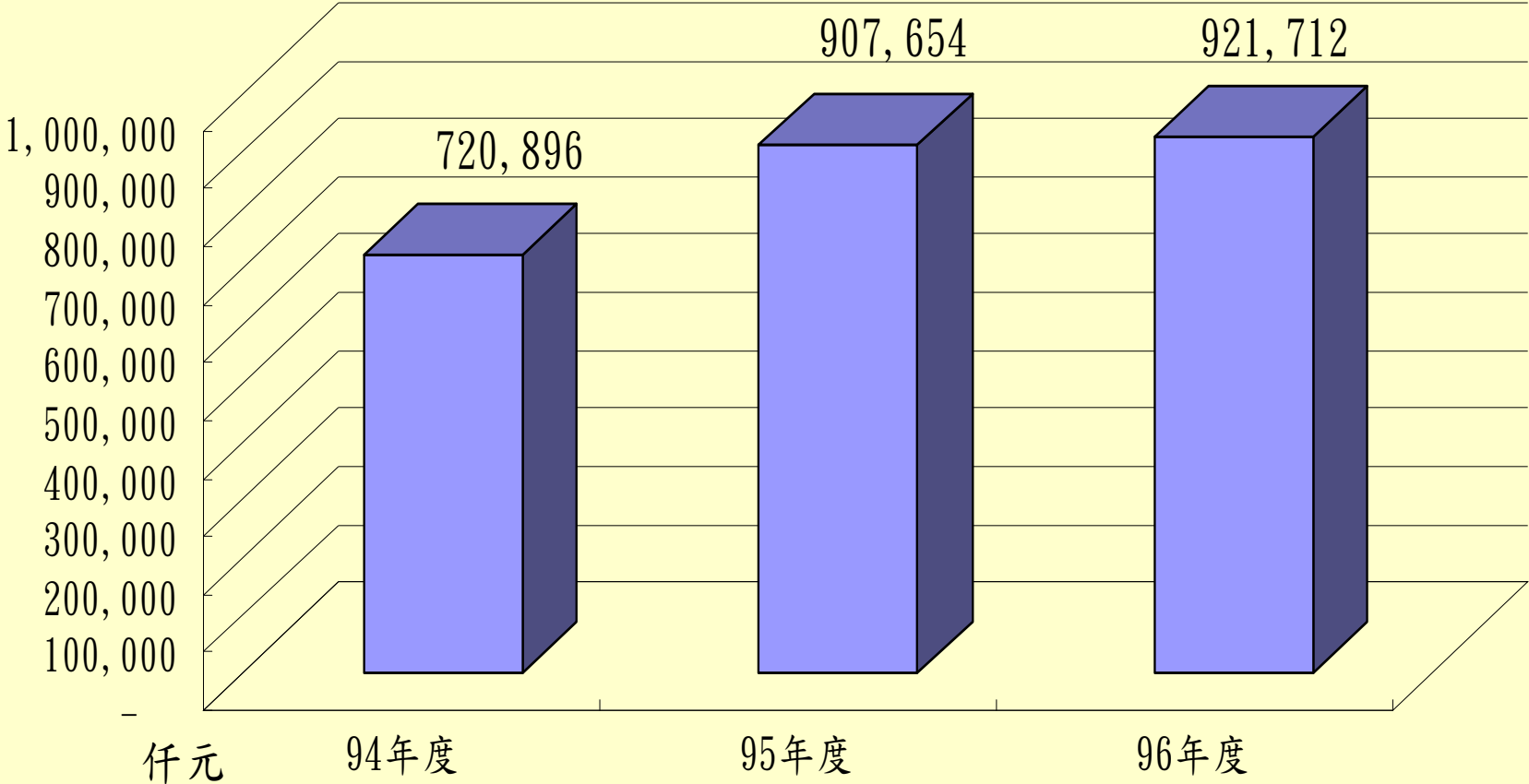
主要客戶-光電及太陽能

SHT

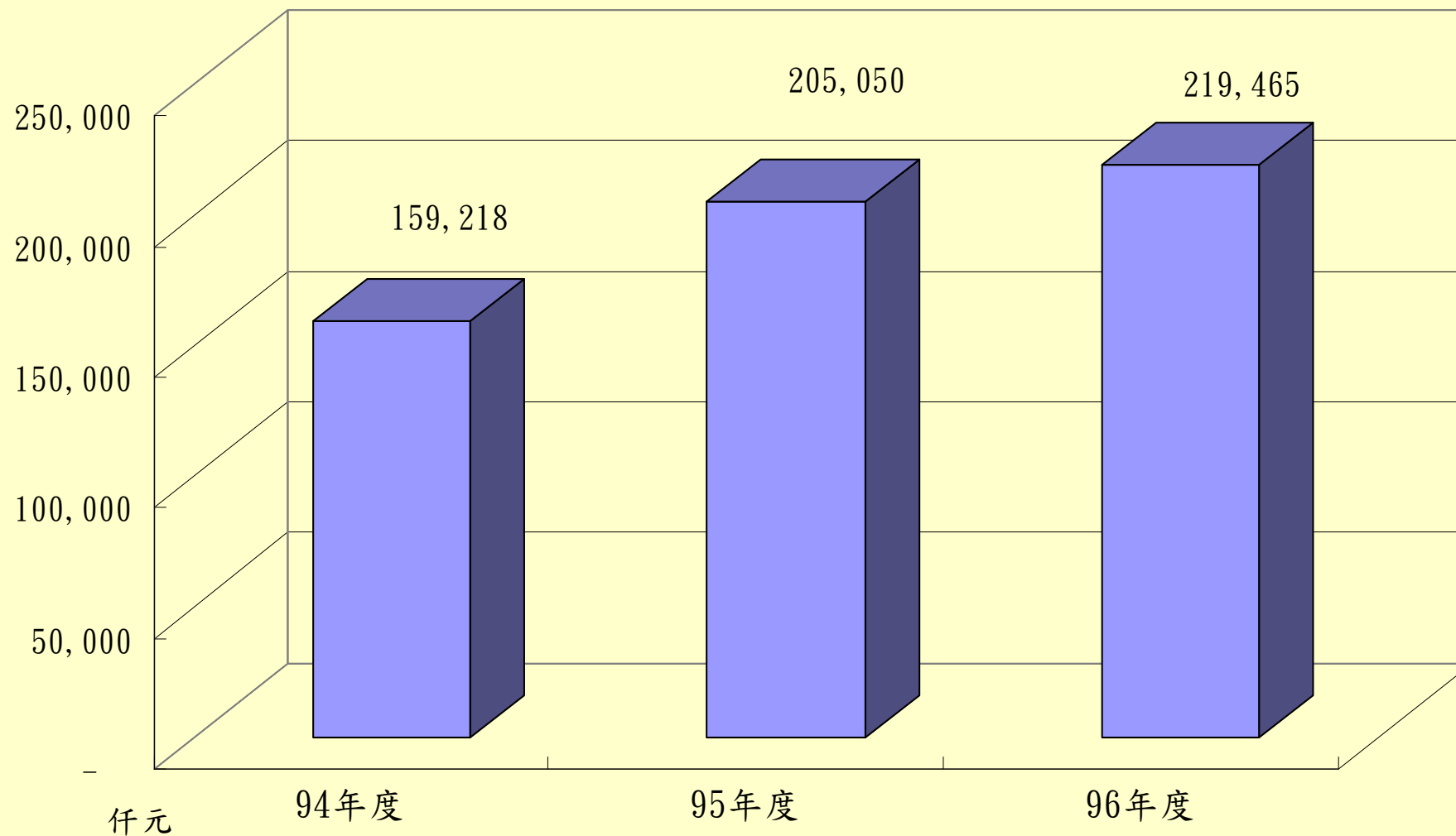


三、經營實績

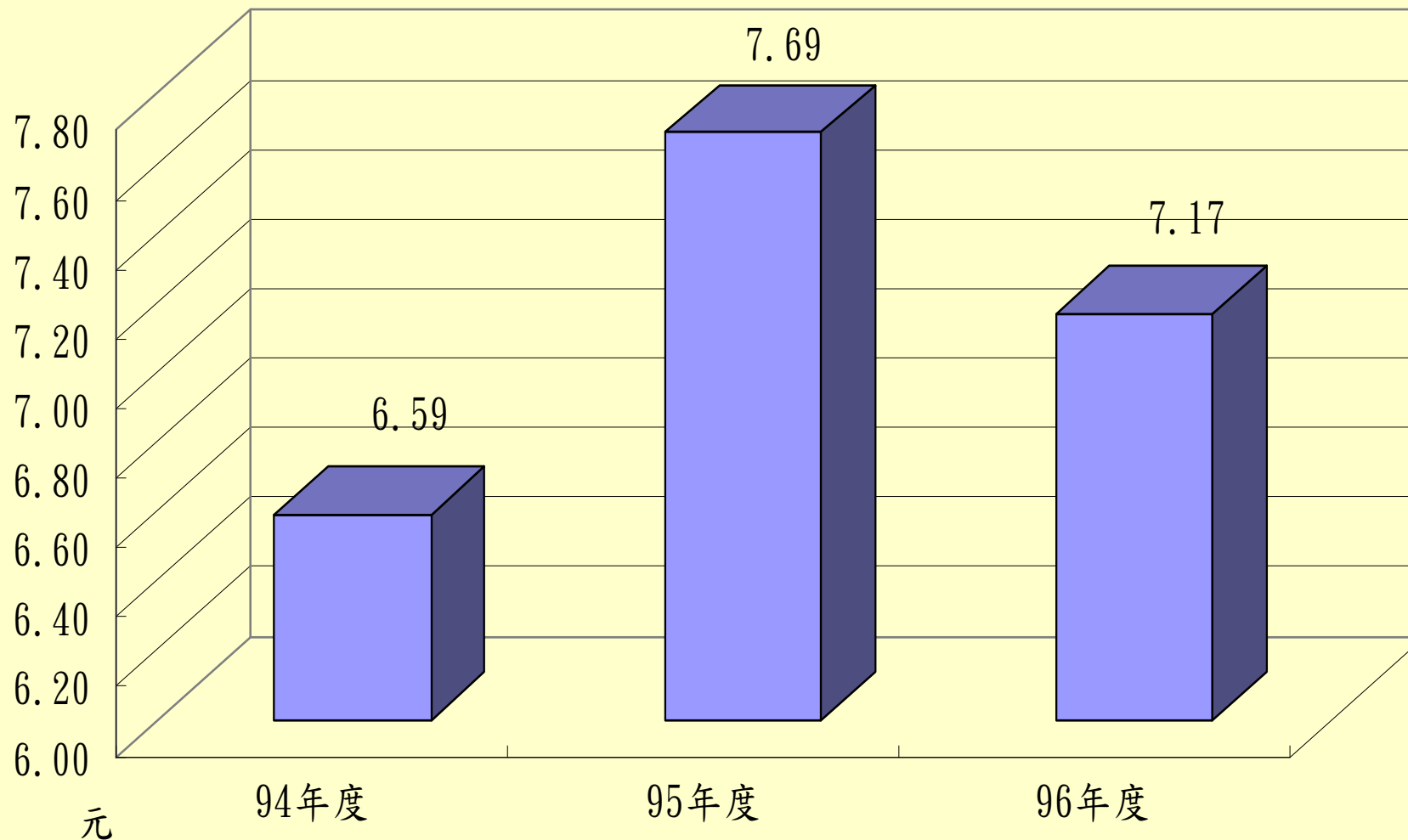
最近三年度營業收入



最近三年度稅後淨利



最近三年度每股盈餘



四、競爭利基

- 先驅-最早投入精密洗淨及再生處理技術之公司。
- 效率-高效率交貨能力，有效提升客戶營運效能。
- 品質-穩定度優於同業，品質獲客戶肯定。
- 國際化-具備跨國服務實績及海外接單能力。
- 產業廣度-橫跨半導體、光電及太陽能三大產業。

1. 尖端洗淨技術之先驅

- 由日方半導體設備廠商參與投資並技術指導，後持續建立自有技術能力，每年亦不斷推出全新之洗淨處理製程技術。

2. 市占率領先同業

- PVD類產品洗淨技術量產能力強並有效降低生產處理成本，可提供客戶最合理之收費並確保競爭力之領導地位。

3. 具備國際服務及行銷經驗

- 首家具備國際服務行銷實績之精密零件洗淨廠，區域含蓋美國、日本、新加坡及菲律賓之國際市場服務。

五、研發成果及未來計畫

研發成果



年度	研發成果
91年	<ul style="list-style-type: none">成功開發 8” Wafer Chamber Heater再生表面Profile控制研磨技術。
93年	<ul style="list-style-type: none">成功開發Al電弧熔射於大面積工件之Robot自動化施工技術。
94年	<ul style="list-style-type: none">成功開發 TFT Array Gen. 5 & 6 PVD Chamber元件表面處理技術。
95年	<ul style="list-style-type: none">成功開發12”Wafer Quartz/Al₂O₃元件表面陶瓷熔射技術。成功開發TFT Array Gen.5,6&7 Panel Carrier 鋁合金新品製作技術。
96年	<ul style="list-style-type: none">成功開發 12” 90 Nano Wafer Encore Ta 製程設備元件表面處理技術。成功開發國產化電弧熔射用Al線材節省關鍵製程成本40%以上。

未來研發計畫重點



研發專案	主要用途
<ul style="list-style-type: none">• 開發高壓水刀大面積厚膜除膜技術。	<ul style="list-style-type: none">• 用以提升大型TFT LCD製程設備工件厚膜除膜效率並降低洗淨成本。
<ul style="list-style-type: none">• 開發新配方之高性能鋁合金陽極處理技術，以提升半導體CVD及Etcher lines之技術突破點。	<ul style="list-style-type: none">• 用以拓展本公司原本市佔有率較低之CVD及Etcher lines 零件洗淨市場。
<ul style="list-style-type: none">• 藉由國際技術合作，開發Gen.7.5及Gen.8之大型TFT及Color Filter設備關鍵元件之CNC精密加工技術。	<ul style="list-style-type: none">• 建立零件洗淨加新品製作之全方位TKM services 能量(Total Solution Service Provider)。
<ul style="list-style-type: none">• 開發特殊製程技術(Special Processes) SHT-SP6 /SP7/SP8整合設備、設備元件清洗及設備模組客制化之完整服務價值鏈市場。	<ul style="list-style-type: none">• 用於高溫及高真空之精密零件洗淨技術，開拓金字塔頂端之高單價及高附加價值洗淨製程技術。

未來發展之有利因素



1.學習曲線長，潛在競爭者跨入門檻高

2.精密洗淨及再生處理技術持續領先

3.具經濟規模及專業分工優勢

4.有效營運模式，易於快速複製

新興市場開拓

- 建立世禾科技成功商業模式(Business Model)之標準模組，於半導體及光電之國際新興市場，分別快速且精準地複製成長。
- 高精密設備元件再生洗淨業之完整價值鏈 (Total Solution Provider for Parts Cleaning Value Chain) 建立，即包含高單價元件精密機械加工及新特殊製程應用等能量之積極建立。

創新洗淨技術

- 開發高壓水刀除膜技術，針對大面積及厚膜之應用，可有效提升世禾科技於TFT-Array元件洗淨之市場占有率。
- 開發新配方之高性能鋁合金陽極處理技術(Code SHT-1 Al₂O₃)，以提供世禾科技於半導體CVD及Etcher lines之技術突破點。

新建廠房計畫



1、新竹行政大樓---約820坪，預計7月完工

2、研發總部及特殊製程廠---約1800坪，預計12月完工

3、台南廠新建7.5代和8.5代TFT-LCD Parts 洗淨廠---約1700坪，預計11月完工

4、深圳廠新建廠房---約3000坪，預計12月完工



世禾科技股份有限公司

Shih-Her Technologies Inc.

報告完畢 · 敬請指教

www.sht.com.tw